

2024年2月5日

会社名 株式会社 ブイ・テクノロジー
代表者 代表取締役 兼 社長執行役員 杉本 重人
(コード番号：7717 プライム市場)
問合せ先 社長室 IR グループ長 吉村 省吾
(TEL：045-338-1980)

半導体フォトマスク用レジストレーション装置「PMARS」1号機を出荷

株式会社ブイ・テクノロジー（本社：神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134横浜ビジネスパークイーストタワー9F 代表取締役 兼 社長執行役員 杉本 重人、以下「当社」）は、半導体用フォトマスクレジストレーション装置「PMARS」の1号機を出荷しましたので、下記にご報告いたします。



(写真)出荷の様子

記

1. 背景

交通(モビリティ)の電動化の進展等を背景に、パワー系のICやディスクリート等の半導体については、中長期の持続的な市場成長が見込まれています。また、パワー半導体需要の拡大に加えて、地政学的な視点での各国の産業政策の後押し等から、各国で設備投資が継続的に実施されています。

このような半導体の製造に不可欠なフォトマスクについても、需要拡大に対応する新工場の建設や、既存工場の設備更新等の投資が各国で計画されています。

当社は、FPD用のガラス基板および同じ用途のフォトマスクの測定装置開発で培った技術を基盤に、PMARSの製品開発を2021年より着手、2022年にセミコンジャパンで発表いたしました。多くの引合い頂戴する中で、培ったコア技術を活かし短期間で量産用装置の製品化に成功、1月に初号機を出荷いたしました。

2. フォトマスクレジストレーション装置「PMARS（ピーマース）」

PMARS(Photo Mask Registration System)は、半導体用フォトマスクのレジストレーション(マスク上に形成された電子回路の幅やアライメントマークの位置)を精密に測定、露光機の補正に不可欠な信頼性の高いマスクの出荷検査データをユーザーに提供します。

独自開発の専用光学系と精密ステージ制御が実現する超解像技術を搭載、重ね合わせ測定再現性について3ナノメートル(10億分の1メートル)、ローテーションによる測定再現性で7ナノメートルを実現しています。

<特長>

専用設計された当社独自の測定光学系

高解像画像処理アルゴリズム

高剛な顕微鏡システム



(図)外観イメージ

3. 今後について

基本仕様の定価を4億5千万円とし、年間の販売台数については10台程度を見込んでおります。また、来期以降の業績への本格的な寄与を目指しております。

今後は、さらに微細な回路の設計ルールに対応できる新しい技術の開発を急ぐと共に、業務提携やM&A等によるビジネスパートナーの獲得による事業の強化にも積極的に取り組み、地域を超え世界中のお客様へソリューションを提供するべく、尽力してまいります。

以上